

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 3 区分
【発行日】平成24年4月12日 (2012.4.12)

【公開番号】特開2010-218150(P2010-218150A)
【公開日】平成22年9月30日 (2010.9.30)
【年通号数】公開・登録公報2010-039
【出願番号】特願2009-63273(P2009-63273)
【国際特許分類】

G 0 6 F 19/00 (2011.01)

【 F I 】

G 0 6 F 19/00 6 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月16日 (2012.2.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

前記頂点に配置された前記ダミー遺伝子の座標と、前記評価遺伝子の座標との距離を求め、前記頂点の座標に対して、予め設定された距離内の座標に位置する評価遺伝子を抽出する類似発現条件検索部を

さらに有することを特徴とする請求項3に記載の発現プロファイル解析システム。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

前記座標変換処理部が、対応分析処理部が求める各次元において、行スコアの寄与率が高い次元からその寄与率を積算し、積算結果の累積寄与率を予め設定した閾値と比較することにより、前記頂点からなる図形を、1次元、2次元または3次元のいずれかにて表示することを特徴とする請求項3から請求項 5 のいずれかに記載の発現プロファイル解析システム。